(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-317709

(43)公開日 平成6年(1994)11月15日

(51)Int.Cl.⁵
G 0 2 B 5/30

識別記号 庁内整理番号

9018-2K

6/12 N 8106-2K

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平5-130106

(22)出願日 平成5年(1993)5月7日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 安藤 慎治

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72) 発明者 松浦 徹

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 佐々木 重邦

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(74)代理人 弁理士 中本 宏 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 ポリイミド系光導波路型偏光子

(57)【要約】

【目的】 製造が容易でしかも耐熱性に優れた低損失の 導波路型偏光子を提供する。

【構成】 埋め込み型光導波路構造におけるコア及びクラッドの両方がポリイミドで構成され、コアのTE偏光に対する屈折率がクラッドのTE偏光に対する屈折率よりも小さく、かつコアのTM偏光に対する屈折率がクラッドのTM偏光に対する屈折率よりも大きいポリイミド系光導波路型偏光子。あるいは前記とは逆に、コアのTE偏光に対する屈折率がクラッドのTM偏光に対する屈折率がクラッドのTM偏光に対する屈折率よりも小さいポリイミド系光導波路型偏光子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 埋め込み型光導波路構造におけるコア及びクラッドの両方がポリイミドで構成され、コアのTE偏光に対する屈折率がクラッドのTE偏光に対する屈折率よりも小さく、かつコアのTM偏光に対する屈折率がクラッドのTM偏光に対する屈折率よりも大きいことを特徴とするポリイミド系光導波路型偏光子。

【請求項2】 埋め込み型光導波路構造におけるコア及びクラッドの両方がポリイミドで構成され、コアのTE偏光に対する屈折率がクラッドのTE偏光に対する屈折率よりも大きく、かつコアのTM偏光に対する屈折率がクラッドのTM偏光に対する屈折率よりも小さいことを特徴とするポリイミド系光導波路型偏光子。

【請求項3】 テトラカルボン酸又はその誘導体と、下記の構造式(化1):

【化1】

$$\begin{array}{c}
C F_3 \\
H_2 N \longrightarrow \\
F_3 C
\end{array}$$

で表されるジアミンから合成されるポリイミドを含むことを特徴とする請求項1に記載のポリイミド系光導波路型偏光子。

【請求項4】 テトラカルボン酸又はその誘導体と、構造式(化1)で表されるジアミンから合成されるポリイミドを含むことを特徴とする請求項2に記載のポリイミド系光導波路型偏光子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光導波路型偏光子に関し、特に耐熱性及び光透過性に優れたプラスチック系の 光導波路型偏光子に関する。

[0002]

【従来の技術】光通信システムの実用化に伴い、光信号を電気信号に変換することなく光のまま処理する交換装置等の開発が急務となっている。そのためには基本的な光部品の開発が不可欠であるが、中でも光導波路中を伝播する光信号のTE偏光成分あるいはTM偏光成分のどちらかを選択的に伝播させ、他方を光導波路外へ放射する機能を持った光導波路型偏光子の高性能化と低価格化が重要である。また、この導波路型偏光子には、集積回路や電気配線と混載実装するためのハンダ耐熱性(270)も合せて必要とされている。

【0003】図2及び図3は従来型の導波路型偏光子を 説明する図であって、図2は埋め込み型、図3はリッジ 型の構成を示している。1は基板、2はクラッド、3は コア、4はバッファ層、5は装荷膜である。ここで、基 板はシリコン、クラッドは酸化シリコン、コアは金属あ 50

るいは半導体をドープした酸化シリコンによって形成さ れるのが一般的である。また、マルチモード導波路の場 合にはコアの下部のみにクラッドを形成した図3の構造 とすることも多い。従来型の導波路型偏光子として、装 荷膜として金属を用いた金属装荷型偏光子、異方性光学 結晶を用いた結晶薄膜装荷型偏光子、半導体を用いた半 導体装荷型偏光子がある。例えば、金属装荷型偏光子の 場合、装荷膜である金属はコア及びバッファ層よりもか なり大きな屈折率を持つため、コア層を伝播する光のう ち、装荷膜に対して垂直方向の電界をもつTM偏光成分 は選択的にコア外へ放射されるが、TE偏光成分はほと んど影響を受けずにそのまま伝播する。金属装荷型偏光 子については、導波路の上面に金属膜を付与するという 光導波路の製作とは異なった別のプロセスを用いる必要 があることに加え、光導波路の導波モードの偏光方向が TE方向に限定されるという問題点があった。また、結 晶薄膜装荷型偏光子、半導体装荷型偏光子については、 金属装荷型偏光子と同様、光導波路に半導体膜を付与す るという別のプロセスを用いる必要があることに加え、 20 装荷膜の膜厚を精密に制御することによってTEあるい はTMどちらかの偏光成分を取り出すことが可能である ものの膜厚制御に高度な技術が要求されるなどの問題点

があった。 【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】従来の技術で示したように、光導波路の上面に薄膜を装荷する偏光子はプロセスの煩雑性と困難性において問題があった。本発明は、これらの問題点を解決し、製造が容易でしかも耐熱性に優れた低損失の導波路型偏光子を提供することを目的と30 する。

[0005]

40

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明はポリイミド系光導波路型偏光子に関する発明であ って、その発明の第1は、埋め込み型光導波路構造にお けるコア及びクラッドの両方がポリイミドで構成され、 コアのTE偏光に対する屈折率(n_™)がクラッドのT E偏光に対する屈折率よりも小さく、かつコアのTM偏 光に対する屈折率(n™)がクラッドのTM偏光に対す る屈折率よりも大きいことを特徴とする。ここでTE偏 光とは、電界の方向が基板と平行である直線偏光を指 し、またTM偏光とは、電界の方向が基板と垂直である 直線偏光を指している。本発明の第2は、同じく埋め込 み型光導波路構造におけるコア及びクラッドの両方がポ リイミドで構成され、コアのTE偏光に対する屈折率が クラッドのTE偏光に対する屈折率よりも大きく、かつ コアのTM偏光に対する屈折率がクラッドのTM偏光に 対する屈折率よりも小さいことを特徴とする。

【0006】図1は本発明における光導波路型偏光子の断面構造を説明する図であって、1は基板、2はクラッド、3はコアを示す。ここで、2のクラッド及び3のコ

アの片方あるいは両方は、n ™ とn ™ が異なる複屈折性 のポリイミドで作製されている。図4は、コアのn™が クラッドのnπ より小さく、かつコアのnm がクラッド の n ™ より大きくなるように設計された光導波路型偏光 子に円偏光を入射したときの光の伝播状態を示してお り、図中(a)ではTE偏光方向の屈折率分布と偏光子 中でのTE偏光のふるまいを、また図中(b)ではTM 偏光方向の屈折率分布と偏光子中でのTM偏光のふるま いを示している。TE偏光に対するコアの屈折率はクラ ッドの屈折率よりも高い構造となっているためTE偏光 は伝播するが、TM偏光に対してはコアの屈折率がクラ ッドの屈折率よりも低い構造となっているため光はコア 外へ放射されて光導波路を伝播しない。結果としてこの 光導波路にはTE偏光成分の光のみが伝播する偏光子と なる。これは、本発明における前記第1の発明の光導波 路型偏光子の原理に相当している。また同様に、コア材 の n π がクラッド材の n π より大きく、かつコア材の n ™ がクラッド材のn™ より小さい場合には、TMモード の光だけが伝播する偏光子となる。これは、本発明にお ける前記第2の発明の光導波路型偏光子の原理に相当し 20 ている。

【0007】上記の原理に従って、TE偏光に対する屈折率とTM偏光に対する屈折率が異なる複屈折性の汎用プラスチック材料をコア及びクラッドに用いることにより、導波路上面に薄膜を装荷することなく導波路型偏光子を作製することが可能と考えられる。しかし、一般に使われているポリスチレンやポリカーボネートのような非晶性プラスチック材料は軟化点が100 付近と耐熱性に問題があり、また吸水率が高いなど環境安定性にも問題があるため他の光電子部品との混載が難しく、光通信用部品としての適性に欠ける。また、複屈折の値が小さいことから、消光比の値が大きくとれないことが予想される。

【 0 0 0 8 】一方、エンジニアリングプラスチックの 1 つであるポリイミドはハンダ耐熱性を持つばかりでなく、結晶性が低いため 0 . 8 5 μ mを超える近赤外領域、特に 1 . 3 μ mや 1 . 5 5 μ mの光通信領域で透明性を持つことが知られている〔例えば、 P . L . ダン (P . L . Dunn) ほか、 Prep. of EOA 2 , Int. Conf. on Elec., Opt., & Acou. Prop. of Mater.、Univ. Kent、Caterbury, U . K . (1990) 〕。

【0009】本発明者らは既に特開平4-9807号において、下記の構造式(化1):

[0010]

【化1】

$$\begin{array}{c}
C F_{3}^{4} \\
H_{2} N \longrightarrow \\
 F_{3} C
\end{array}$$

【0011】に示した2,2 - ビス(トリフルオロメチル)-4,4 - ジアミノビフェニルと2種類のテトラカルボン酸二無水物を用いてポリイミド共重合体を得ることにより屈折率を自由に制御できること、フッ素化ポリイミドの熱処理条件を変えることによって溶媒に対する溶解性を制御できること、これらのフッ素化ポリイミドをコア及びクラッドに用いることにより低光損失の埋め込み型光導波路が形成できることを見出している。該ポリイミドの耐熱温度は300 以上であり、電子材料として重要な特性であるハンダ耐熱性を十分に保持している。更にスピンコート法により、容易に大面積導波路が作製できるという利点を持ち、導波路の低価格化が可能である。

【0012】本発明者らは、上述のフッ素化ポリイミドがコア及びクラッドに用いて種々の埋め込み型光導波路を作製し、それらの光損失を測定していった結果、一部のコア/クラッドの組合せからなる導波路については、コアに直線偏光を入射させた場合、導波路に対する偏光の方向を回転させることによってその導波路損失が大きく変化することを見出した。その後、更に検討を進めた結果、コアとクラッドの材料組成を変化させることによって、30dBを超える高い消光比を持つ光導波路型偏光子に必要とされる特性は、偏光子としての特性である消光比を除けば、光導波路のそれと同様であり、本発明にかかる光導波路型偏光子がハンダ耐熱性や光透過性など光導波路としての優れた特性を示すことは、既に特開平4-9807号公報で述べた通りである。

【0013】本発明に用いるテトラカルボン酸及びその 誘導体としての酸無水物、酸塩化物、エステル化物等と しては、例えば以下のようなものが挙げられる。ここで はテトラカルボン酸としての名称を掲げる。

【0014】ピロメリット酸、トリフルオロメチルピロ 40 メリット酸、ペンタフルオロエチルピロメリット酸、ビ ス{3,5-ジ(トリフルオロメチル)フェノキシ}ピ ロメリット酸、2,3,3,4-ビフェニルテトラ カルボン酸、3,3,4-テトラカルボキシジ フェニルエーテル、2,3,3,4-テトラカルボ キシジフェニルエーテル、3,3,4-テトラカルボ キシジフェニルエーテル、3,3,4-デトラカルボ キシジフェニルエーテル、3,3-4,4-デトラカルボキシナフタレン、1,4,5,6-テトラカルボキシナフタレン、1,4,5,6-テトラカルボキシナフタレン、3,3,4,4-テトラカルボキシジフェ 50 ニルメタン、3,3,4,4-テトラカルボキシジ

フェニルスルホン、2,2-ビス(3,4-ジカルボキ シフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,4-ジカル ボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、5,5-ビス(トリフルオロメチル) - 3,3,4,4-テ トラカルボキシビフェニル、2,2,5,5-テト ラキス(トリフルオロメチル) - 3 , 3 , 4 , 4 -テトラカルボキシビフェニル、5,5-ビス(トリフ ルオロメチル) - 3 , 3 , 4 , 4 - テトラカルボキ シジフェニルエーテル、5,5-ビス(トリフルオロ メチル) - 3 , 3 , 4 , 4 - テトラカルボキシベン ゾフェノン、ビス { (トリフルオロメチル) ジカルボキ シフェノキシ } ベンゼン、ビス { (トリフルオロメチ ル)ジカルボキシフェノキシ}(トリフルオロメチル) ベンゼン、ビス(ジカルボキシフェノキシ)(トリフル オロメチル)ベンゼン、ビス(ジカルボキシフェノキ シ)ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン、ビス(ジカ ルボキシフェノキシ)テトラキス(トリフルオロメチ ル)ベンゼン、3,4,9,10-テトラカルボキシペ リレン、2,2-ビス{4-(3,4-ジカルボキシフ ェノキシ)フェニル}プロパン、ブタンテトラカルボン 酸、シクロペンタンテトラカルボン酸、2,2-ビス { 4 - (3 , 4 - ジカルボキシフェノキシ) フェニル } ヘキサフルオロプロパン、ビス { (トリフルオロメチ ル)ジカルボキシフェノキシ}ビフェニル、ビス{(ト リフルオロメチル)ジカルボキシフェノキシ}ビス(ト リフルオロメチル)ビフェニル、ビス { (トリフルオロ メチル)ジカルボキシフェノキシ}ジフェニルエーテ ル、ビス(ジカルボキシフェノキシ)ビス(トリフルオ ロメチル)ビフェニル、ビス(3,4-ジカルボキシフ ェニル) ジメチルシラン、1,3-ビス(3,4-ジカ 30 ルボキシフェニル)テトラメチルジシロキサン、1,4 - ビス(3,4 - ジカルボキシトリフルオロフェノキ シ)テトラフルオロベンゼン、1,4-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ) オクタフルオロ ビフェニル、1,4-ジフルオロピロメリット酸、1-トリフルオロメチル・4・フルオロピロメリット酸、 1,4-ジ(トリフルオロメチル)ピロメリット酸、1 - ペンタフルオロエチル - 4 - フルオロピロメリット 酸、1-ペンタフルオロエチル-4-トリフルオロメチ ルピロメリット酸、1,4-ジ(ペンタフルオロエチ ル)ピロメリット酸、1-ペンタフルオロフェニル-4 - フルオロピロメリット酸、1 - ペンタフルオロフェニ ル-4-トリフルオロメチルピロメリット酸、1-ペン タフルオロフェニル・4・ペンタフルオロエチルピロメ リット酸、1,4-ジ(ペンタフルオロフェニル)ピロ メリット酸、1-トリフルオロメトキシ-4-フルオロ ピロメリット酸、1 - トリフルオロメトキシ - 4 - トリ フルオロメチルピロメリット酸、1 - トリフルオロメト キシ・4・ペンタフルオロエチルピロメリット酸、1・

ロメリット酸、1,4-ジ(トリフルオロメトキシ)ピ ロメリット酸、1 - ペンタフルオロエトキシ - 4 - フル オロピロメリット酸、1-ペンタフルオロエトキシ-4 - トリフルオロメチルピロメリット酸、1 - ペンタフル オロエトキシ・4 - ペンタフルオロエチルピロメリット 酸、1-ペンタフルオロエトキシ-4-ペンタフルオロ フェニルピロメリット酸、1 - ペンタフルオロエトキシ - 4 - トリフルオロメトキシピロメリット酸、1,4-ジ(ペンタフルオロエトキシ)ピロメリット酸、1-ペ ンタフルオロフェノキシ・4 - フルオロピロメリット 酸、1-ペンタフルオロフェノキシ-4-トリフルオロ メチルピロメリット酸、1 - ペンタフルオロフェノキシ - 4 - ペンタフルオロエチルピロメリット酸、1 - ペン タフルオロフェノキシ・4・ペンタフルオロフェニルピ ロメリット酸、1-ペンタフルオロフェノキシ-4-ト リフルオロメトキシピロメリット酸、1 - ペンタフルオ ロフェノキシ - 4 - ペンタフルオロエトキシピロメリッ ト酸、1,4-ジ(ペンタフルオロフェノキシ)ピロメ リット酸、ヘキサフルオロ-3,3,4,4 - ビフ ェニルテトラカルボン酸、ヘキサフルオロ-3,3 4,4 - ジフェニルエーテルテトラカルボン酸、ヘキ サフルオロ・3,3,4,4,ベンゾフェノンテト ラカルボン酸、ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオ ロフェニル)スルホン、ビス(3,4-ジカルボキシト リフルオロフェニル)スルフィド、ビス(3,4-ジカ ルボキシトリフルオロフェニル)ジフルオロメタン、 1,2-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェ ニル)テトラフルオロエタン、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、1,4-ビス(3,4-ジカルボキシトリフル オロフェニル) テトラフルオロベンゼン、3,4-ジカ ルボキシトリフルオロフェニル - 3 , 4 - ジカルボ キシトリフルオロフェノキシ - ジフルオロメタン、ビス (3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)ジフ ルオロメタン、1,2‐ビス(3,4‐ジカルボキシト リフルオロフェノキシ)テトラフルオロエタン、2,2 - ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキ シ)ヘキサフルオロプロパン、1,4-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロ 40 ベンゼン、2,3,6,7-テトラカルボキシ-テトラ フルオロナフタレン、2,3,6,7-テトラカルボキ シ-ヘキサフルオロアントラセン、2,3,6,7-テ トラカルボキシ - ヘキサフルオロフェナントレン、2, 3,6,7-テトラカルボキシ-テトラフルオロビフェ ニレン、2,3,7,8-テトラカルボキシ-テトラフ ルオロジベンゾフラン、2,3,6,7-テトラカルボ キシ-テトラフルオロアントラキノン、2,3,6,7 - テトラカルボキシ - ペンタフルオロアントロン、2, 3 , 7 , 8 - テトラカルボキシ - テトラフルオロフェノ トリフルオロメトキシ-4-ペンタフルオロフェニルピ 50 キサチイン、2,3,7,8-テトラカルボキシ-テト

ラフルオロチアントレン、2,3,7,8-テトラカルボキシ-テトラフルオロジベンゾ〔b,e〕1,4ジオキサンなどである。この中でピロメリット酸のベンゼン環にフルオロアルキル基を導入した含フッ素酸二無水物であるトリフルオロメチルピロメリット酸二無水物、1,4-ジ(トリフルオロメチル)ピロメリット酸二無水物、1,4-ジ(ペンタフルオロエチル)ピロメリット酸二無水物等の製造方法は特願昭63-165056号明細書に記載されている。

【0015】また、本発明に用いるジアミンとしては、 例えば以下のようなものが挙げられる。m - フェニレン ジアミン、2,4-ジアミノトルエン、2,4-ジアミ ノキシレン、2,4-ジアミノデュレン、4-(1H, 1H,11H-エイコサフルオロウンデカノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン、4-(1H,1H-パーフ ルオロ・1・ブタノキシ)・1,3・ジアミノベンゼ ン、4-(1H,1H-パーフルオロ-1-ヘプタノキ シ) - 1,3-ジアミノベンゼン、4-(1H,1H-パーフルオロ・1-オクタノキシ)-1,3-ジアミノ ベンゼン、4-ペンタフルオロフェノキシ-1,3-ジ アミノベンゼン、4-(2,3,5,6-テトラフルオ ロフェノキシ) - 1,3 - ジアミノベンゼン、4 - (4 - フルオロフェノキシ) - 1,3-ジアミノベンゼン、 4-(1H,1H,2H,2H-パーフルオロ-1-へ キサノキシ) - 1,3 - ジアミノベンゼン、4 - (1 H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロ-1-ドデカノキ シ) - 1,3-ジアミノベンゼン、p-フェニレンジア ミン、2,5-ジアミノトルエン、2,3,5,6-テ トラメチル - p - フェニレンジアミン、2,5 - ジアミ 30 ノベンゾトリフルオライド、ビス(トリフルオロメチ ル)フェニレンジアミン、ジアミノテトラ(トリフルオ ロメチル)ベンゼン、ジアミノ(ペンタフルオロエチ ル)ベンゼン、2,5-ジアミノ(パーフルオロヘキシ ル)ベンゼン、2,5-ジアミノ(パーフルオロブチ ル)ベンゼン、ベンジジン、2,2 - ジメチルベンジ ジン、3,3-ジメチルベンジジン、3,3-ジメ トキシベンジジン、2,2 - ジメトキシベンジジン、 3,3,5,5-テトラメチルベンジジン、3, 3 - ジアセチルベンジジン、2,2 - ビス(トリフ 40 ルオロメチル) - 4,4 - ジアミノビフェニル、3, 3 - ビス(トリフルオロメチル) - 4 , 4 - ジアミ ノビフェニル、4,4 - ジアミノジフェニルエーテ ル、4,4 - ジアミノジフェニルメタン、4,4 -ジアミノジフェニルスルホン、2,2-ビス(p-アミ ノフェニル)プロパン、3,3-ジメチル-4,4 - ジアミノジフェニルエーテル、3,3 - ジメチル -4,4 - ジアミノジフェニルメタン、1,2-ビス (アニリノ)エタン、2,2-ビス(p-アミノフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、1,3-ビス(アニリ

ノ) ヘキサフルオロプロパン、1,4-ビス(アニリ ノ)オクタフルオロブタン、1,5-ビス(アニリノ) デカフルオロペンタン、1,7-ビス(アニリノ)テト ラデカフルオロヘプタン、2,2 - ビス(トリフルオ ロメチル) - 4 , 4 - ジアミノジフェニルエーテル、 3,3 - ビス(トリフルオロメチル) - 4,4 - ジ アミノジフェニルエーテル、3,3,5,5-テト ラキス(トリフルオロメチル) - 4,4 - ジアミノジ フェニルエーテル、3,3-ビス(トリフルオロメチ 10 ル) - 4, 4 - ジアミノベンゾフェノン、4, 4 -ジアミノ - p - テルフェニル、1,4 - ビス(p - アミ ノフェニル)ベンゼン、p - ビス(4 - アミノ - 2 - ト リフルオロメチルフェノキシ)ベンゼン、ビス(アミノ フェノキシ)ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン、ビ ス(アミノフェノキシ)テトラキス(トリフルオロメチ ル)ベンゼン、4,4 - ジアミノ-p-クォーター フェニル、4,4 - ビス(p-アミノフェノキシ)ビ フェニル、2,2-ビス{4-(p-アミノフェノキ シ)フェニル}プロパン、4,4 - ビス(3-アミノ フェノキシフェニル)ジフェニルスルホン、2,2-ビ ス { 4 - (4 - アミノフェノキシ) フェニル } ヘキサフ ルオロプロパン、2,2-ビス{4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル}ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス { 4 - (2 - アミノフェノキシ) フェニル } ヘキサ フルオロプロパン、2,2-ビス{4-(4-アミノフ ェノキシ) - 3,5-ジメチルフェニル}ヘキサフルオ ロプロパン、2,2-ビス{4-(4-アミノフェノキ シ) - 3,5-ジトリフルオロメチルフェニル}ヘキサ フルオロプロパン、4,4 - ビス(4-アミノ-2-トリフルオロメチルフェノキシ)ビフェニル、4,4 - ビス(4-アミノ-3-トリフルオロメチルフェノキ シ)ビフェニル、4,4 - ビス(4-アミノ-2-ト リフルオロメチルフェノキシ)ジフェニルスルホン、 4,4 - ビス(3-アミノ-5-トリフルオロメチル フェノキシ)ジフェニルスルホン、2,2-ビス{4-(4-アミノ-3-トリフルオロメチルフェノキシ)フ ェニル } ヘキサフルオロプロパン、ビス { (トリフルオ ロメチル)アミノフェノキシ}ビフェニル、ビス 〔{(トリフルオロメチル)アミノフェノキシ}フェニ ル〕ヘキサフルオロプロパン、ジアミノアントラキノ ン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノナ フタレン、ビス〔{2-(アミノフェノキシ)フェニ ル } ヘキサフルオロイソプロピル 〕 ベンゼン、ビス (2,3,5,6-テトラフルオロ-4-アミノフェニ ル)エーテル、ビス(2,3,5,6-テトラフルオロ - 4 - アミノフェニル) スルフィド、1,3 - ビス(3 - アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン、1,4 - ビス(3 - アミノプロピルジメチルシリル)ベンゼ ン、ビス(4-アミノフェニル)ジエチルシラン、テト ラフルオロ・1,2・フェニレンジアミン、テトラフル

オロ・1,3・フェニレンジアミン、テトラフルオロ・ 1,4-フェニレンジアミン、ヘキサフルオロ-1,5 - ジアミノナフタレン、ヘキサフルオロ - 2 , 6 - ジア ミノナフタレン、3-トリフルオロメチル-トリフルオ ロ・1,2・フェニレンジアミン、4・トリフルオロメ チル・トリフルオロ・1,2・フェニレンジアミン、2 - トリフルオロメチル - トリフルオロ - 1 , 3 - フェニ レンジアミン、4 - トリフルオロメチル - トリフルオロ - 1 , 3 - フェニレンジアミン、5 - トリフルオロメチ ル・トリフルオロ・1,3・フェニレンジアミン、2・ トリフルオロメチル・トリフルオロ・1,4・フェニレ ンジアミン、3,4-ビス(トリフルオロメチル)-ジ フルオロ・1,2-フェニレンジアミン、3,5-ビス (トリフルオロメチル) - ジフルオロ - 1 , 2 - フェニ レンジアミン、2,4-ビス(トリフルオロメチル)-ジフルオロ・1,3-フェニレンジアミン、4,5-ビ ス(トリフルオロメチル) - ジフルオロ - 1,3 - フェ ニレンジアミン、4,6-ビス(トリフルオロメチル) - ジフルオロ - 1 , 3 - フェニレンジアミン、2 , 3 -ビス(トリフルオロメチル) - ジフルオロ - 1 , 4 - フ 20 ェニレンジアミン、2,5-ビス(トリフルオロメチ ル) - ジフルオロ - 1 , 4 - フェニレンジアミン、3 , 4,5-トリス(トリフルオロメチル)-フルオロ-1,2-フェニレンジアミン、3,4,6-トリス(ト リフルオロメチル) - フルオロ - 1 , 2 - フェニレンジ アミン、2,4,5-トリス(トリフルオロメチル)-フルオロ・1,3・フェニレンジアミン、2,4,6・ トリス(トリフルオロメチル)-フルオロ-1,3-フ ェニレンジアミン、4,5,6-トリス(トリフルオロ メチル) - フルオロ - 1,3 - フェニレンジアミン、テ トラキス(トリフルオロメチル) - 1,2-フェニレン ジアミン、テトラキス(トリフルオロメチル)-1,3 - フェニレンジアミン、テトラキス(トリフルオロメチ ル) - 1, 4-フェニレンジアミン、3-ペンタフルオ ロエチル・トリフルオロ・1,2・フェニレンジアミ ン、4-ペンタフルオロエチル-トリフルオロ-1,2 - フェニレンジアミン、2 - ペンタフルオロエチル - ト リフルオロ・1,3-フェニレンジアミン、4-ペンタ フルオロエチル - トリフルオロ - 1 , 3 - フェニレンジ アミン、5 - ペンタフルオロエチル - トリフルオロ -1,3-フェニレンジアミン、2-ペンタフルオロエチ ル-トリフルオロ-1,4-フェニレンジアミン、3-トリフルオロメトキシ・トリフルオロ・1,2・フェニ レンジアミン、4 - トリフルオロメトキシ - トリフルオ ロ-1,2-フェニレンジアミン、2-トリフルオロメ トキシ・トリフルオロ・1,3・フェニレンジアミン、 4 - トリフルオロメトキシ - トリフルオロ - 1 , 3 - フ ェニレンジアミン、5 - トリフルオロメトキシ - トリフ ルオロ・1,3-フェニレンジアミン、2-トリフルオ ロメトキシ・トリフルオロ・1,4・フェニレンジアミ 50

ン、3,3-ジアミノ-オクタフルオロビフェニル、 3,4-ジアミノ-オクタフルオロビフェニル、4, 4 - ジアミノ - オクタフルオロビフェニル、2,2 - ビス(トリフルオロメチル) - 4,4 - ジアミノへ キサフルオロビフェニル、3,3-ビス(トリフルオ ロメチル) - 4 , 4 - ジアミノヘキサフルオロビフェ ニル、ビス(3-アミノ-テトラフルオロフェニル)エ ーテル、3,4 - ジアミノ - オクタフルオロジフェニ ルエーテル、ビス(4-アミノ-テトラフルオロフェニ ル)エーテル、3,3-ジアミノ-オクタフルオロベ ンゾフェノン、3,4 - ジアミノ-オクタフルオロベ ンゾフェノン、4,4 - ジアミノ - オクタフルオロベ ンゾフェノン、ビス(3-アミノ-テトラフルオロフェ ニル)スルホン、3,4-ジアミノ-オクタフルオロ ジフェニルスルホン、ビス(4-アミノ-テトラフルオ ロフェニル)スルホン、ビス(3-アミノ-テトラフル オロフェニル)スルフィド、3,4 - ジアミノ-オク タフルオロジフェニルスルフィド、ビス(4-アミノ-テトラフルオロフェニル)スルフィド、ビス(4-アミ ノテトラフルオロフェニル)ジフルオロメタン、1,2 - ビス(4-アミノテトラフルオロフェニル)テトラフ ルオロエタン、2,2-ビス(4-アミノテトラフルオ ロフェニル) ヘキサフルオロプロパン、4,4・ジア ミノ - ドデカフルオロ - p - テルフェニル、4 - アミノ - テトラフルオロフェノキシ - 4 - アミノ - テトラフ ルオロフェニル - ジフルオロメタン、ビス(4 - アミノ - テトラフルオロフェノキシ) - ジフルオロメタン、 1,2-ビス(4-アミノ-テトラフルオロフェノキ シ) - テトラフルオロエタン、2,2-ビス(4-アミ ノ-テトラフルオロフェノキシ) - ヘキサフルオロプロ パン、1,4-ビス(4-アミノ-テトラフルオロフェ ノキシ) - テトラフルオロベンゼン、2,6-ジアミノ - ヘキサフルオロナフタレン、2,6-ジアミノ-オク タフルオロアントラセン、2,7-ジアミノ-オクタフ ルオロフェナントレン、2,6-ジアミノ-ヘキサフル オロビフェニレン、2,7-ジアミノ-ヘキサフルオロ ジベンゾフラン、2,6-ジアミノ-ヘキサフルオロア ントラキノン、2,6-ジアミノ-オクタフルオロアン トロン、2,7-ジアミノ-ヘキサフルオロフェノキサ 40 チイン、2,7-ジアミノ-ヘキサフルオロチアントレ ン、2,7-ジアミノ-テトラフルオロジベンゾ〔b, e] 1, 4ジオキサンなどである。

【0016】中でも得られるポリイミドの吸水率を低く保ち、近赤外域のみならず可視域にも光透過性の高い領域を広げるためには、テトラカルボン酸又はその誘導体とジアミンのいずれか、あるいはその双方にフッ素原子が結合したものを原料として用いることが好ましく、更には、構造式(化1)に示した2,2 - ビス(トリフルオロメチル) - 4,4 - ジアミノビフェニルをジアミンとして用いることが好ましい。2,2 - ビス(ト

リフルオロメチル) - 4, 4 - ジアミノビフェニルの 製造方法は、例えば日本化学会誌、第3号、第675~ 676頁(1972)に記載されている。

【0017】テトラカルボン酸又はその誘導体とジアミ ンを反応させることによりポリアミド酸を製造する。ポ リアミド酸の製造方法は、通常のポリアミド酸の製造条 件と同じでよく、一般的にはN-メチル-2-ピロリド ン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチル ホルムアミドなどの極性有機溶媒中で反応させる。本発 明においては、ジアミン及びテトラカルボン酸又はその 10 誘導体とも単一化合物で用いるばかりではなく、複数の ジアミン、テトラカルボン酸又はその誘導体を混合して 用いる場合がある。その場合は、複数又は単一のジアミ ンのモル数の合計と複数又は単一のテトラカルボン酸又 はその誘導体のモル数の合計が等しいか、ほぼ等しくな るようにする。次いで得られたポリアミド酸のイミド化 によるポリイミドの合成については、通常のポリイミド の合成法が使用できる。本発明においては、単一のポリ アミド酸のイミド化のほか、複数のポリアミド酸を混合 いる。

【0018】本発明の光導波路型偏光子の構造は、これ まで一般に製造されている埋め込み型の光導波路と同様 でよく、より詳しくは特開平4-9807号公報で明ら かにしたとおりである。光の伝播モードとしては、シン グルモード型、マルチモード型とも、コアの形状とサイ ズ、コア及びクラッドの屈折率を制御することにより製 造が可能である。コアの断面形状は、正方形である場合 に、より大きな径でシングルモードが達成できるという ことはあるものの、必ずしも正方形である必要がなく、 一般に知られている埋め込み型光導波路の電磁界解析法 を用いてその形状を設計することができる。

【0019】光導波路のコアとクラッドの材料について は、コア又はクラッドにおける屈折率の大小関係がTE 偏光方向とTM偏光方向で逆転し、かつその差が大きい ことが、消光比の高い光導波路型偏光子を作製する上で 効果的である。これは一般に複屈折の大きなポリイミド と小さなポリイミドをコア、クラッドの材料として組合 せることにより達成される。ポリイミド単体としての化 学構造と複屈折の関係は、これまでラッセルら〔 T. P. Russell ほか、ジャーナル オブ ポリマーサイエ ンス ポリマー フィジックス(J.Poly, Sci. Poly m. Phys.)、第22巻、第1105頁(198

12

4)]、ロイターら[R.Reuterほか、アプライド オ プティックス (Appl. Opt.)、第27巻、第4565頁 (1988)]、ハーミングハウスら〔S. Herminghau s ほか、アプライド フィジックス レターズ (Appl. Phys. Lett.) 第59巻、第1043頁(1991)] などにより報告されて来てはいる。一般にポリイミドの 酸無水物部分あるいはジアミン部分が2つ以上のベンゼ ン環から構成され、それらの間がエーテル基(-O -)、スルホン基(-SO₂-)、ヘキサフルオロイソ プロピリデン基〔 - C (C F 3) 2 - 〕に代表される屈 曲性の回転可能な結合で結ばれている場合には複屈折が 小さくなること、他方、酸無水物部分あるいはジアミン 部分の少なくとも片方が1つのベンゼン環から構成さ れ、あるいは2つ以上のベンゼン環から構成される場合 でもそれらの間が単結合で結ばれている場合には複屈折 が大きくなることが明らかとされてきた。しかし、コア とクラッドの整合性を含めて異なった複屈折を有するポ リイミドを光導波路に用いることはなされていない。本 発明においては、コアとクラッドの材料を選択する1つ した状態でイミド化を行い、ポリイミドの混合体も得て 20 の目安として、1つはピロメリット酸二無水物やp.フ ェニレンジアミンのような分子構造に剛直性を与える原 料を用いたポリイミドとし、他の1つは2,2‐ビス (3,4-ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロ パン二無水物や3,3・ジアミノジフェニルスルホン のような分子構造に柔軟性を与える原料を用いたポリイ ミドとすることに留意をした。

[0020]

【実施例】以下、いくつかの実施例を用いて本発明を更 に詳しく説明する。なお上述した様なコアとクラッドの 満たすべき関係があるものの種々のポリイミドの組合せ により、また光導波路の構造により数限りない本発明の ポリイミド光導波路型偏光子が得られることは明らかで あり、本発明はこれらの実施例のみに限定されるもので はない。

【0021】本実施例に用いたポリイミド及びその混合 物のTE偏光に対する屈折率(nπ)、TM偏光に対す る屈折率(n_™)、平均の屈折率及び複屈折(n;n т - n m) を表 1 及び表 2 に示す。また、本実施例の光 導波路に用いたコア材、クラッド材と、用いたポリイミ 40 ドの関係を表3にまとめて示した。

[0022]

【表1】

13 14 表1 実施例 1~4 で使用したポリイミド及びポリイミド共重合体の屈折率

番号	酸二無水物	ジアミン	n _{TE}	птм	平均の 屈折率	Δn
1	ピロメリット酸二無水物	2. ビリロ)4 アフィー・シビル (ルチ4ーノニ	1. 6144	1. 4912	1. 5733	0. 1232
2	2, 2 ービス(3, 4 ージカ ルボキシフェニル)へキサフ ルオロプロパン二無水物		1. 5227	1. 5145	1. 5200	0. 0082
3	番号1の酸二無水物 90mol% 番号2の酸二無水物 10mol%		1. 5947	1. 4983	1. 5626	0. 0964
4	番号1の酸二無水物 10mol% 番号2の酸二無水物 90mol%		1. 5239	1. 5156	1. 5211	0. 0083
5	番号1の酸二無水物 70mol% 番号2の酸二無水物 30mol%		1. 5698	1. 5105	1. 5500	0. 0593
6	番号1の酸二無水物 30mol% 番号2の酸二無水物 70mol%		1. 5311	1. 5190	1. 5271	0. 0121

[0023]

* * 【表2】 表2 実施例5で使用したポリイミド混合物の屈折率

番	10 .) > > > \			平均の	
号	ポリイミド混合物	П те	П тм	屈折率	Δn
7	表1中番号1のポリイミド 90mol%	1, 5953	1. 4988	1, 5631	0, 0965
	表1中番号2のポリイミド 10mol%				
8	表1中番号1のポリイミド 10mol%	1, 5238	1. 5154	1, 5210	0. 0084
	表1中番号2のポリイミド 90mol%				

[0024]

【表3】

表3 本実施例で使用したコアの材料とクラッドの材料

	コアの材料	クラッドの材料
実施例1	番号1のポリイミド	番号2のポリイミド
実施例2	番号2のポリイミド	番号1のポリイミド
実施例3	番号3のポリイミド	番号4のポリイミド
実施例4	番号 5 のポリイミド	番号6のポリイミド
実施例 5	番号7のポリイミド	番号8のポリイミド

【0025】屈折率は(株)メトリコン社製のプリズム カプラー(PC2000型)を用い、室温23 、波長 1.32 μ m で 測定した。また、実施例で作製した光導 波路型偏光子の消光比の測定は、光検出器(パワーメー ター)に接続したシングルモードファイバーを導波路コ アの一方の端面にあて、もう一方のコアの端面からシン 20 グルモード偏波保存ファイバー(パンダファイバー)で 波長1.32μmの直線偏光(消光比40dB以上)を 入射し、その入射面を回転させながら出射パワーの変化 を見ることで行った。

【0026】本実施例の1で示した表1中の番号1のポ リイミドと、同番号2のポリイミドは、屈折率の大小関 係がTE偏光方向とTM偏光方向で逆転しており、かつ その差が大きいため、光導波路型偏光子を作製する上で 都合がよい。また、番号1のポリイミドと番号2のポリ イミドの共重合体及び混合物は、そのn 〒 が 1 . 5 2 2 30 7から1.6144、そのn™が1.4912から1. 5 1 4 5 の間に存在し、かつ屈折率が組成とともに連続 的に変化するため、偏光子の特性を予測して設計する目 的にも適している。

【 0 0 2 7 】実施例 1

表面に3 μ mの酸化シリコン層を形成した直径3インチ のシリコンウェハに表1中の番号2のポリイミドの前駆 体であるポリアミド酸のジメチルアセトアミド溶液を加 熱後の膜厚が30μmになるようにスピンコート法によ り塗布した。この塗膜を最高温度350 で熱処理をし て下部クラッド層を形成した。引続いてこの下部クラッ ド層の上に表1の番号1のポリアミド酸のジメチルアセ トアミド溶液を加熱後の膜厚が10μmになるようにス ピンコート法により塗布した。この塗膜を最高350 で熱処理をしてコア層を形成した。次に電子ビーム蒸着 機により、アルミニウムの層を0.3μm形成した後、 レジスト加工を行った。まず通常のポジ型レジストをス ピンコート法により塗布した後約95 でプリベークを 行った。次に線幅10µm、長さ60mmのパターン形

照射した後、ポジ型レジスト用の現像液を用いて現像し た。その後135 でアフターベークをした。次にレジ ストでコートされていないアルミニウムのウエットエッ チングを行った。洗浄乾燥後ドライエッチング装置を用 いポリイミドのコアのエッチング加工を行った。ポリイ ミドの上層にあるアルミニウムを上記のエッチング液で 除去し、表1中の番号2のポリアミド酸のジメチルアセ トアミド溶液を加熱後の膜厚が 1 0 μ m になるように再 度スピンコート法により塗布した。この塗膜を最高温度 350 で熱処理をして上部クラッド層を形成した。最 後にこの光導波路をシリコン基板ごとダイシングソーで 切り出し、コアの両端面を光学研磨して測定試料とし

【0028】図5はこの方法により作製された光導波路 型偏光子の消光比を示す実験データである。すなわち図 5は偏波ファイバ回転角(度、横軸)と受光パワー(d Bm、縦軸)との関係を示すグラフである。偏波保存フ ァイバーにより基板と平行方向の直線偏光(TE偏光) を入射したときの受光パワーが - 3 d B m であったのに 対して、入射の偏光面を90°回転させ、基板と垂直方 向の直線偏光(TM偏光)を入射したときの受光パワー は - 33 d B m であり、消光比にして30 d B という優 れた特性が得られた。この導波路はTE偏光を選択的に 透過させる。また、偏光子としての挿入損失は7dBm であり、従来型の偏光子と比較してもそん色がない。

40 【0029】実施例2

実施例1において使用した番号1のポリイミドの前駆体 であるポリアミド酸の代りに番号2のポリイミドの前駆 体であるポリアミド酸を、また実施例1において使用し た番号2のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代 りに番号 1 のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸を 用いて、実施例1と同様の方法で光導波路型偏光子を作 製した。この偏光子にTE偏光を入射したときの受光パ ワーが-35dBmであったのに対し、TM偏光を入射 したときの受光パワーは - 7 d B m であり、消光比にし 成用マスクを通して超高圧水銀ランプを用いて紫外線を 50 て28dBという優れた特性が得られた。この偏光子は

実施例1とは反対にTM偏光を選択的に透過させる。偏 光子としての挿入損失は8dBmであった。

17

【0030】実施例3

実施例1において使用した番号1のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代りに表1中の番号3のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸を、また実施例1において使用した番号2のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代りに表1中の番号4のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸を用いて、実施例1と同様の方法で光導波路型偏光子を作製した。この偏光子10にTE偏光を入射したときの受光パワーが-4dBmであったのに対し、TM偏光を入射したときの受光パワーは-35dBmであり、消光比は31dBであった。偏光子としての挿入損失は6dBmであった。

【0031】実施例4

実施例1において使用した番号1のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代りに表1中の番号5のポリイミド共重合体の前駆体であるポリアミド酸を、また実施例1において使用した番号2のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代りに表1中の番号6のポリイミド共重20合体の前駆体であるポリアミド酸を用いて、実施例1と同様の方法で光導波路型偏光子を作製した。この偏光子にTE偏光を入射したときの受光パワーが-6dBmであったのに対し、TM偏光を入射したときの受光パワーは-17dBmであり、消光比は11dBであった。偏光子としての挿入損失は6dBmであった。

【0032】実施例5

実施例1において使用した番号1のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代りに表2中の番号7のポリイミ*

* ド前駆体であるポリアミド酸の混合物を、また実施例 1 において使用した番号 2 のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の代りに表 2 中の番号 8 のポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の混合物を用いて、実施例 1 と同様の方法で光導波路型偏光子を作製した。この偏光子にTE偏光を入射したときの受光パワーが - 1 5 d B mであったのに対し、T M偏光を入射したときの受光パワーは - 4 0 d B mであり、消光比は 2 5 d B であった。偏光子としての挿入損失は 8 d B mであった。

0 [0033]

【発明の効果】本発明によれば従来の金属装荷型偏光子、結晶薄膜装荷型偏光子、半導体装荷型偏光子に代って、構成部材がポリイミドであるために、製造が容易でしかも耐熱性が良好な光導波路型偏光子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の偏光子の断面構造を示す図である。

【図2】従来からの光導波路型偏光子の構造の代表例の1つを示す図である。

20 【図3】従来からの光導波路型偏光子の構造の他の代表 例示す図である。

【図4】本発明の偏光子の光の伝播方向の断面を示し、 本発明の偏光子の機構を説明する図である。

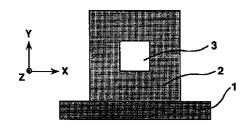
【図5】本発明の実施例1における偏光子の消光比測定の実験結果を示す図である。

【符号の説明】

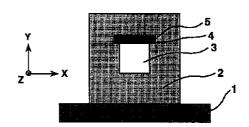
1:基板、2:クラッド、3:コア、4:バッファ層、

5:装荷膜

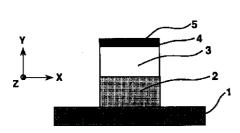
【図1】

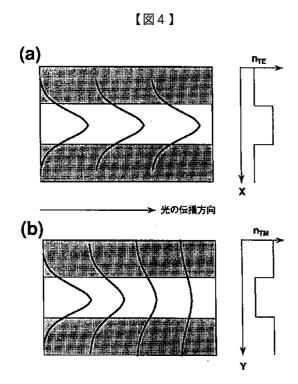


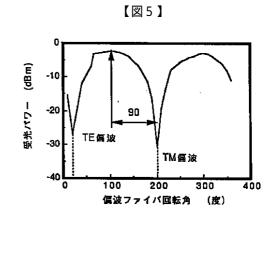
【図2】



【図3】







フロントページの続き

(72)発明者 澤田 孝

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内

(72)発明者 高原 秀行

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内

(72)発明者 小池 真司

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内

(72)発明者 下川 房男

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内